

COMPASS系列 匹配器



快速、高效的阻抗匹配

阻抗匹配器通过数字化的匹配算法，尽可能降低了反射功率，在阻抗匹配范围内，3秒内即可实现匹配点的匹配，它能为不同的等离子体应用例如（CVD、PVD、等离子体清洗、溅射、溅射以及刻蚀）提供高效、快速的匹配功能。

宽泛、灵活的匹配范围

具有27种不同电感线圈组合的L型匹配网络提供了宽泛而又灵活的匹配范围，能对应不同等离子体应用的需求，同时可根据客户的需求，我们现场工程师可为帮客户选择适合需求的线圈组合。

多种匹配模式

阻抗匹配器具有自动、手动两种工作模式，自动模式下让客户无须其他操作实现匹配功能，手动操作可以根据客户需求移动电容的位置实现匹配范围内的任意匹配。

高品质的元器件

采用高质量的可变电容器和电感线圈，能延长匹配器的寿命，同时确保等离子体应用过程中出现的停机时间最小化。

远程控制功能

射频电源的前面板以及VFP软件可以远程操作和监控匹配器的状态，这可大大降低直接面对带有功率的匹配器的风险。

DC Bias监测

阻抗匹配器内置有DC Bias电路，能监控负载中产生的DC Bias电压，DC Bias电压值可在射频电源的前面板和VFP软件中观测得到。

应用领域

- ◆ HDP~CVD
- ◆ PECVD
- ◆ Etch~ICP/RIE
- ◆ PVD
- ◆ Plasma Cleaning

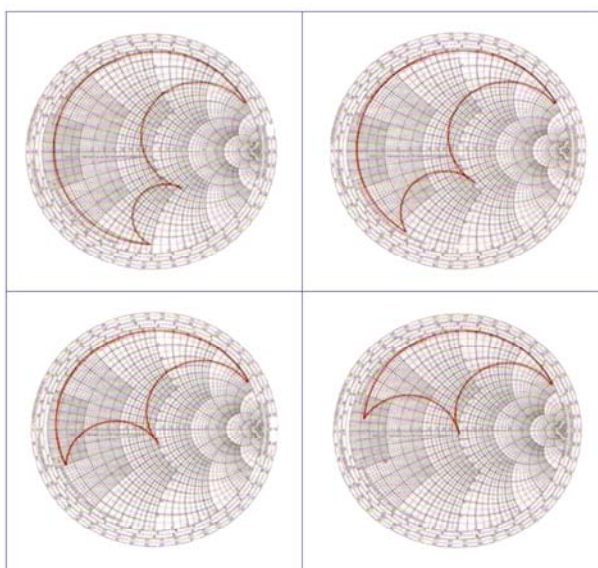


图1 不同线圈组合在史密斯图中的匹配范围

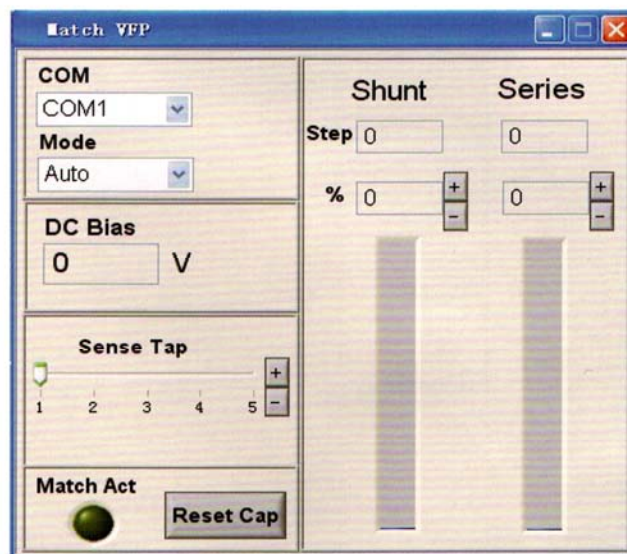


图2 可用于监测和控制匹配器的VFP软件